Rac'd PCT/PTO 16 SEP 2005

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

REC'D	2	1 APR 2005
WIPO		PCT

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 TU04~0126W01	今後の手続きについては、様式PCT/	IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/001914	国際出願日 (日. 月. 年) 19. 02. 2004	優先日 (日.月.年) 17.03.2003
国際特許分類(IPC)Int.Cl. ⁷ C23C14,	/34, H01L21/28, H01L21/285, H01	1L21/768, C22C9/01, C22C9/02
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ	·	

	、PCT35条に基づきこの国際予 57条(PCT36条)の規定に従い		と国際予備審査報告である。	;
2. この国際予備領	審査報告は、この表紙を含めて全	部で5	_ ページからなる。	
3. この報告には a. 🔽 附属書	次の附属物件も添付されている。 類は全部で 2 ^	ページである。		
	されて、この報告の基礎とされた び/又は図面の用紙(PCT規則			r明細書、請求の範
	概4.及び補充概に示したように 予備審査機関が認定した差替え用		出願の開示の範囲を超えた補 正	Eを含むものとこの ·
b. 「 電子媒 配列表 プルを	体は全部で に関する補充棚に示すように、コ 含む。(実施細則第 802 号参照)	ンピュータ読み取り可信		種類、数を示す)。 表に関連するテー
4. この国際予備	審査報告は、次の内容を含む。			
	第IV欄 発明の単一性の欠如	上の利用可能性について 5新規性、進歩性又は産	Cの国際予備審査報告の不作成 業上の利用可能性についての見	

国際予備審査の請求書を受理した日 14.07.2004	国際予備審査報告を作成した日 04.04.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 宮澤 尚之
東京都千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3416

第1概	製告の基礎
1. zo	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
٦	の報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 れは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12. 3及び23. 1 (b) にいう国際調査 PCT規則12. 4にいう国際公開 PCT規則55. 2又は55. 3にいう国際予備審査
2. この た <i>差</i> 替え	股告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条(PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され H紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
Γ	出願時の国際出願書類
V	明細杏
	第 1 - 1 0、1 2 - 1 5 ページ、出願時に提出されたもの 第 1 1 ページ*、1 4.07.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
V	請求の範囲
	第 1-10、12-15 項、出願時に提出されたもの 第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 11、16-18 項*、14.07.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
_	図面
·	第 ページ/図 、出願時に提出されたもの 第 ページ/図 *、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図 *、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充概を参照すること。
a	#正により、下記の 書類が削除された。
. ,	明細書 第
4. 「	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
	明細書 第 ページ 請求の範囲 第 項 図面 第 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4. (该当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第Ⅲ	棚 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
	次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
Г	国際出願全体
V	が
理由	: この国際出願又は請求の範囲 大の事項を内容としている(具体的に記載すること)。
ᅜ	明細改、請求の範囲若しくは図面 (次に示す部分) 又は請求の範囲 <u>11-13、16-18</u> の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない (具体的に記載すること) 。 第1222 第222 第222 第222 第222 第222 第222 第22
	範囲11~13および16~18に記載された発明を把握できない。
	よって、請求の範囲11~13および16~18に対して見解を示すことができない。
_	全部の請求の範囲又は請求の範囲が、明細書による十分な
	裏付けを欠くため、見解を示すことができない。
Γ	請求の範囲について、国際調査報告が作成されていない。
<u> </u>	ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が、実施細則の附属 書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細 書等の作成のためのガイドライン)に定める基準を、次の点で満たしていない。
	書面による配列表が 提出されていない。
	「
Γ	コンピュータ読み取り可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表に関連するテーブルが、実施細則の附属書 Cの2に定める技術的な要件を、次の点で満たしていない。
	
	詳細については補充欄を参照すること。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/001914

. 見解		
新規性(N)	請求の 範囲 <u>1-10、14、15</u>	有
	請求の範囲	無
進歩性(IS)	請求の範囲 1-10、14、15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-10、14、15	
•	請求の範囲	無

文献1:JP 2002-4048 A (株式会社荏原製作所) 2002.01.09

文献2:JP 2001-284358 A (富士通株式会社) 2001.10.12

文献3:JP 2002-294437 A (三菱マテリアル株式会社) 2002.10.09

文献4:JP 11-158614 A (日立金属株式会社) 1999.06.15

(1)請求の範囲1~10、14、15は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性を有 する。上記文献には、「AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含 有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有すること」が記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、「シート抵抗が小さくかつ凝集がなく、安定で均一なシード層を形成」できるという有利な効果を発揮する。

第四個 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

(1)請求の範囲11には、「Al又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt% 含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを 特徴とする銅合金スパッタリングターゲットのスパッタ膜」と記載されている。

当該記載は、「AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする 銅合金ターゲット」を用いたスパッタリングにより形成された膜を示しているものと認められる。しかしながら、同じターゲットを用いてもスパッタ条件等により得られる膜の組成や物性等は変化するものであるから、「AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5(未満)wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットの」との表現で修飾されている「スパッタ膜」が具体的にどのようなものを示すものなのか不明瞭である。

(2)請求の範囲16についても(1)で示した同じ理由により、不明瞭である。

表1

4 (9)	12	5	20	12	18	15	13	Ξ	91	13	13	6	14		21	18	13	25	
膜厚均一性 (3σ%)						L													
凝集性	海集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性なし	凝集性なし	凝集性なし	凝集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性極めて低い	凝集性なし	凝集性なし	凝集性強い	凝集性あり	凝集性あり		凝集性強い	凝集性あり	凝集性強い	凝集性低い	
粒径パラッキ 凝集性 (%)	19	13	16	13	16	17	18	18	19	13	15	6	11		17	15	18	29	, AS合計
平均粒径("m)	96	70	85	46	61	52	36	61	44	27	63	22	43		91	43	63	19	*Sb. Zr. Ti. Cr. Ag. Au. Cd. In. As合計
酸素 (ppm)	<5 <5	~ 5	V	-	- V	~ 5	~ 5	V	- - -	- - -	^ 5	<5 <5	\		~ 5	<5	^ 5	9	Ti.Cr./
*Sb等	0.13	0.25	0.16	0.32	0.32	0.26	0.29	0.16	0.46	0.32	0.17	0.34	0.53		0.22	0.23	0.71	0.55	*Sb. Zr.
Mn(ppm)	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.05	0.03	0.17	0.10	0.22	0.21	< 0.001	0.13	0.05		0.03	0.75	0.45	0.22	
Si(ppm)	0.05	0.07	60.0	0.11	0.19	< 0.01	0.05	0.03	< 0.01	<0.01	0.03	0.61	0.36		< 0.01	0.03	0.05	< 0.01	
AI、Sn濃度(目標組成)	0.02wt%Al	0. 05wt%AI	0. 106wt%Al	0. 213wt%AI	0. 427wt%AI	0.02wt%Sn	0. 05wt%Sn	0. 1wt%Sn	0. 25wt%Sn	0. 5wt%Sn	0.008wt%AI	0.86wt%AI	0. 213wt%AI	-	0.005wt%Sn	1. Owt%Sn	0. 25wt%Sn	0. 5wt%Sn	
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7	比較例8	

9. Na、Kがそれぞれ0.02wtppm以下、U、Thがそれぞれ0.5 wtppb以下、酸素1wtppm以下、窒素1wtppm以下、炭素1wtppm以下、炭素1wtppm以下であることを特徴とする請求の範囲第8項記載の銅合金スパッタリングターゲット。

5

20

- 10. 平均結晶粒径が 100 μ m以下であり、平均粒径のばらつきが \pm 20% 以内であることを特徴とする請求の範囲第1項~第9項のいずれかに記載の銅合 金スパッタリングターゲット。
- 11. (補正後) AI又はSnから選んだ少なくとも1元素を0.01~0.5 (未満) wt%含有し、かつMn又はSiのいずれか一方又は双方が総量で0.25wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットのスパッタ膜からなる半導体素子配線。
 - 12. 半導体素子配線のシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第11項記載の半導体素子配線。
- 15 13. Ta、Ta合金又はこれらの窒化物のバリア膜上にシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第12項記載の半導体素子配線。
 - 14. 添加元素の母合金を作製し、これを銅又は低濃度母合金の溶湯に溶解してインゴットとし、このインゴットを加工してターゲットとすることを特徴とする請求の範囲第1項~第10項のいずれかに記載の銅合金スパッタリングターゲットの製造方法。
 - 15. 固溶限以内の母合金を作製することを特徴とする請求の範囲第14項記載の銅合金スパッタリングターゲットの製造方法。
 - 16. (追加) A I 又はS n から選んだ少なくとも 1 元素を 0. 0 1 \sim 0. 5 (未満) w t %含有し、かつM n 又はS i のいずれか一方又は双方が総量で 0.
- 25 25wtppm以下含有する共に、さらにSb, Zr, Ti, Cr, Ag, Au, Cd, In, Asから選択した1又は2以上を総量で1.0wtppm以下含有することを特徴とする銅合金ターゲットのスパッタ膜からなる半導体素子配線。
 - 17. (追加) 半導体素子配線のシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第16項記載の半導体素子配線。
- 30 18. (追加) Ta、Ta合金又はこれらの窒化物のバリア膜上にシード層として形成されることを特徴とする請求の範囲第17項記載の半導体素子配線。

and the second of the Park Andread and Song to

Rec'd PCT/PTO 16 SFP 20 PCT/JP2004/001

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference						
TU04-0126WO1	FOR FURTHER	ACTION	See Form PCT/IPEA/416			
International application No. PCT/JP2004/001914		date (day/month/year) 2004 (19.02.2004)	Priority date (day/month/year) 17 March 2003 (17.03.2003)			
International Patent Classification (IPC) or na C23C 14/34, H01L 21/28, 21/28	tional classification	and IDC				
Applicant	NIKKO MATE	DIALS CO. LTD.				
	THICKO WATE	RIALS CO., LTD.				
This report is the international prelim Authority under Article 35 and transr	inary examination re nitted to the applicar	eport, established by this in according to Article 36.	International Preliminary Examining			
2. This REPORT consists of a total of	5 shee	ts, including this cover sh	neet.			
3. This report is also accompanied by A	NNEXES, comprising	ig:				
a. (sent to the applicant and t	o the International E	Bureau) a total of 2	sheets, as follows:			
sheets of the descri and/or sheets conta Administrative Inst		drawings which have becauthorized by this Author	en amended and are the basis of this report ity (see Rule 70.16 and Section 607 of the			
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.						
b. (sent to the International	icated in the Supple	total of (indicate type aining a sequence listing mental Box Relating to	e and number of electronic carrier(s)) and/or tables related thereto, in computer Sequence Listing (see Section 802 of the			
4. This report contains indications relating	ng to the following it	ems:				
Box No. I Basis of the repo	ort					
Box No. II Priority						
Box No. III Non-establishme	ent of opinion with re	egard to novelty, inventiv	e step and industrial applicability			
Box No. IV Lack of unity of	invention					
[—]		(2) with regard to novelty such statement	y, inventive step or industrial applicability;			
Box No. VI Certain documer Box No. VII Certain defects i	•					
▽	n the international ar					
250 No. VIII Certain observat	ions on the internatio	onal application				
Date of submission of the demand		Date of completion of t	this report			
14 July 2004 (14.07.200	4)	04 A ₁	pril 2005 (04.04.2005)			
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No				

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2004/001914

Box No	. I	Basis of the report	
1. With other	regard wise in	to the language, this report is based on the international application in the languaged under this item.	guage in which it was filed, unless
	This which	report is based on translations from the original language into the following h is language of a translation furnished for the purpose of:	language,
		international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))	
		publication of the international application (under Rule 12.4)	
		international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).	
		·	
juiiii	re not	I to the elements of the international application, this report is based on (the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred annexed to this report): atternational application as originally filed/furnished	replacement sheets which have been d to in this report as "originally filed"
		scription:	
ا الحا	pages	•	
	pages		, as originally filed/furnished 14 July 2004 (14.07.2004)
	pages		14 July 2004 (14.07.2004)
	the cl		
	pages		, as originally filed/furnished
	pages		ther with any statement) under Article 19
	pages	* 11, 16-18 received by this Authority on	14 July 2004 (14.07.2004)
	pages	received by this Authority on	
	the di	awings:	
	pages		, as originally filed/furnished
	pages	received by this Authority on	, as ongas, mod/aminoou
	pages		
	a seq	ence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Seq	mence Listing
			·
3.	The a	mendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
	Ħ	the claims, Nos.	
	H	the drawings, sheets/figs	
	H		
	\forall	the sequence listing (specify):	
	لــا	any table(s) related to sequence listing (specify):	
4.	mauc	eport has been established as if (some of) the amendments annexed to this re since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as if 70.2(c)). the description, pages	port and listed below had not been indicated in the Supplemental Box
L		olies, some or all of those sheets may be marked "superseded."	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001914

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	٠
1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to industrially applicable have not been examined in respect of:	be
the entire international application.	
Claims Nos	
because:	
the said international application, or the said claims Nos.	
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):	•
·	
the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos	
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):	
As explained in Box VIII, because the constitutions of claims 11 and 16 are unclear, the inventions of claims 11-13 and 16-18 cannot be understood.	;
Therefore, an opinion cannot be given concerning claims 11-13 and 16-18.	
the claims, or said claims Nos are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.	
·	1
no international search report has been established for said claims Nos.	
2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acceptance listing to comply with the standard provided for in Appen C of the Administration I.	d
sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: the written form has not been furnished or does not comply with the standard.	-
the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.	
POT/IDEA/400 CD WID (T. L. 1000)	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001914

atement			
Novelty (N)	Claims	1-10, 14, 15	YES
•	Claims		ио
Inventive step (IS)	Claims	1-10, 14, 15	YES
	Claims		мо
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10, 14, 15	YE:
	Claims		МО

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 2002-4048, A (Ebara Corp.), 09 January, 2002 Document 2: JP, 2001-28458, A (Fujitsu Ltd.), 12 October, 2001

Document 3: JP, 2002-294437, A (Mitsubishi Materials Corp.), 09 October, 2002

Document 4: JP, 11-158614, A (Hitachi Metals, Ltd.), 15 June, 1999

(1) Claims 1-10, 14, and 15 appear to involve an inventive step over the documents cited in the ISR. The documents do not describe "at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm." At the same time, the invention of the present application realizes the advantageous effect of thereby being able to "form a stable homogeneous seed layer free from aggregation and with low sheet resistance."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2004/001914

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

(1) Claim 11 describes a "copper alloy sputtering target characterized in that at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm."

This description is found to describe a film formed by sputtering wherein a "copper alloy target

characterized in that at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt.ppm." However, even if the same target is used, the composition and physical characteristics, etc. obtained will differ depending on spatter conditions, etc.; therefore, it is unclear what kind of thing "spatter film" refers to when modified by the expression "copper alloy target characterized in that at least one element selected from among Al and Sn is contained in an amount of 0.01 to less than 0.5 wt.% while the total amount of Mn and Si is not greater than 0.25 wt,ppm."
(2) Claim 16 is unclear for the same reasons as explained in (1).
·